

## サーマルCVD装置 CT-5500



ポリSi(第1炉)、SiO<sub>2</sub>、PSG、BSG(第2炉)、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>(第3炉)をコーティングできます。各炉は、それぞれ独立したCVD炉なので、異質物の混入がありません。1台で3台分の働きをする小ロット生産用CVDです。

### サーマルCVD装置 CT-5500仕様

○膜種	ポリSi/Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> /SiO <sub>2</sub> /PSG/BSG
○炉体サイズ	φ154mm×1150mm
○炉体材質	石英
○基板形状	4インチ 10枚
○到達圧力	×10 <sup>-2</sup> Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 <sup>-1</sup> Pa台迄3分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	1000℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	SiH <sub>4</sub> /O <sub>2</sub> /NH <sub>3</sub> /PH <sub>3</sub> /B <sub>2</sub> H <sub>6</sub> /H <sub>2</sub> /N <sub>2</sub>
○真空排気系	油回転ポンプ:375L/min メカニカルブースターポンプ:100m <sup>3</sup> /h
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気:AC200V三相40KVA 冷却水:25L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上